第13回スパッタリングとプラズマプロセスに関する国際シンポジウム (ISSP 2015)に出席して[†]

日 下 一 也*

Report on "13th International Symposium on Sputtering & Plasma Processes (ISSP 2015)"

by

Kazuya KUSAKA*

今回で13回目となるスパッタリングとプラズマプロセスに関する国際シンポジウム The 13th International symposium on Sputtering & Plasma Processes (ISSP 2015)が7月8日から10日までの3日間、京都リサーチパークにて開催された。1991年に第1回のシンポジウムが金沢で開催されてから2年毎に金沢で開催され、また、第11回からは場所を京都に移して実施されている。本シンポジウムにおける講演件数は、基調講演1件、招待講演10件を含む口頭による発表が37件、ポスターによる発表が108件であった。スパッタリングプロセス、プラズマプロセス、薄膜、マイクロ・ナノ技術、応用技術に関するトピックスで講演募集が行われ、国内外より約250名の参加者が集まり、研究発表および活発な討論で盛り上がった。ヨーロッパやアメリカの著名な研究者が招待講演等で参加する中、台湾から来日した大学教員、研究所研究員、大学生の発表が48件を占めていたのが印象的であった。金属膜、窒化膜、酸化膜、半導体膜、硬質膜、有機膜、多層膜などの形成手法や評価方法の提案、応用事例、新しい製膜技術やプラズマ形成技術の提案、表面改質や膜形成メカニズムの評価手法など様々な研究発表があった。

7月8日、大型台風9号、10号、11号が日本の南の海上に発生して沖縄に接近している中、本シンポジウムは日本真空学会の川上養一教授(京都大学)およびISSP2015実行委員長の加藤和広氏(セントラル硝子(株))の挨拶により始まった。初日の京都は小雨が降っていたものの、二日目以降は雨も上がり夏の京都らしく非常に蒸し暑い一日となり、京都の街は祇園祭で賑わっ

図2 ポスターセッションの様子

ていた。口頭発表の会場は200席ほどある大きな部屋であったが、常に2/3以上の席が埋め尽くされていた。講演会場内は写真撮影禁止となっていたので、京都リサーチパークの入り口に設置していた看板の前で台湾大学生にお願いして記念写真を一枚撮影してもらった(図1)。

本シンポジウムの特徴として、口頭発表者もポスターセッションにてポスター発表を行うことになっている。図2に示すように17時頃から始まるポスターセッションでは軽食と飲料が用意されており、皿やコップを手にした参加者が飲食を楽しみながら議論に花を咲かせた。

9日には同会場にて琴と尺八の生演奏会があり、静かな日本伝統音楽をバックにポスター発表が行われた。

最終日10日のポスターセッション後には、ポスター賞の受賞者3名が選出され、表彰式と写真撮影が行われた。その後、本シンポジウムは閉幕した。

図1 京都リサーチパーク会場入口にて

[†] 原稿受理 平成 27 年 7 月 12 日 Received July 12, 2015 ©2015 The Society of Materials Science, Japan

* 正 会 員 徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部 〒 770-8506 徳島市南常三島町, Institute of Technology and Science, Tokushima University, Minami-josanijima, Tokushima 770-8506.